

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 10 月 17 日(17.10.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/153875 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) B24B 37/20 (2012.01)
B24B 37/013 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/055516
- (22) 国際出願日: 2013 年 2 月 28 日(28.02.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-090241 2012 年 4 月 11 日(11.04.2012) JP
- (71) 出願人: 東洋ゴム工業株式会社(TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 中村 賢治(NAKAMURA, Kenji); 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 ユニウス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒

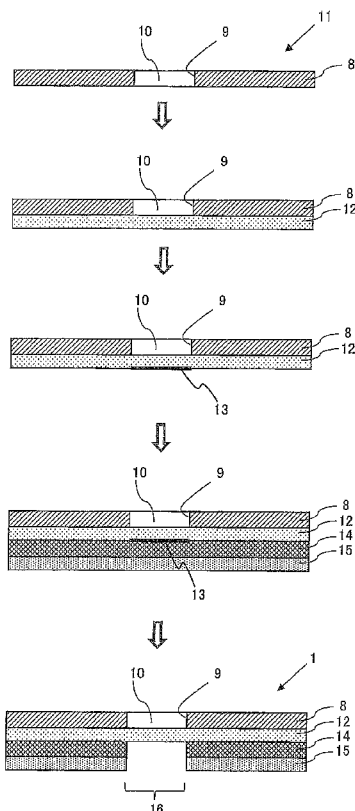
5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 1 3
— 9 新大阪MTビル 1 号館 Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: LAMINATED POLISHING PAD AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: 積層研磨パッド及びその製造方法



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a method for readily producing a laminated polishing pad that is less susceptible to peeling between a polishing layer and a support layer or an intermediate layer even if polishing for a prolonged period causes higher temperatures, and that excels with respect to optical detection accuracy. This method for producing a laminated polishing pad comprises: a step for providing a light transmission region inside an opening (A) of a polishing region and preparing a polishing layer; a step for providing an adhesive member (X) containing a hot-melt adhesive to one side of the polishing layer; a step for providing a peelable protective member to a portion of the adhesive member (X) corresponding to the light transmission region; a step for bonding a support layer to the adhesive member (X) provided with the peelable protective member; and a step for removing the support layer of the portion corresponding to the light transmission region, and further removing the peelable protective member, to form an opening (B).

(57) 要約: 本発明は、長時間の研磨により高温になる場合であっても研磨層と支持層又は中間層との間で剥離しにくく、かつ光学的検知精度に優れる積層研磨パッドを簡易に製造する方法を提供することを目的とする。本発明の積層研磨パッドの製造方法は、研磨領域の開開口部A内に光透過領域を設けて研磨層を作製する工程、前記研磨層の片面にホットメルト接着剤を含む接着部材Xを設ける工程、前記接着部材Xの光透過領域に対応する部分に剥離性保護部材を設ける工程、剥離性保護部材を設けた前記接着部材Xに支持層を貼り付ける工程、及び光透過領域に対応する部分の支持層を除去し、さらに剥離性保護部材を除去して開口部Bを形成する工程を含む。

WO 2013/153875 A1



(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))